

COMPOL

Exotic
Material Polish



この写真はイメージです。This photograph is an image.

COMPOL

COMPOLは、LiTaO₃、LiNbO₃、サファイア等の電子材料基盤、金属材料及びセラミックスのポリシング専用開発された高純度コロイダルシリカスラリーです。粒子の均一性、分散性に優れ、高能率でダメージフリーの研磨面が得られます。

COMPOL

COMPOL is a colloidal silica slurry developed especially for polishing metals, ceramics and electronic substrates such as LiTaO₃, LiNbO₃ and sapphire. With excellent particle uniformity and dispersal, it delivers high-removal rate, damage free polishing. Even when used at high dilutions, COMPOL delivers excellent processing efficiency and long slurry life.

COMPOLの代表的物性 Typical Physical Properties of COMPOL

項目 Item	製品名 Type	20	50	80	120
SiO ₂ 量 Content of SiO ₂ (%)		40	40	40	40
PH		9.2	10.2	10.2	9.2
比重 Specific gravity		1.30	1.30	1.30	1.30
平均粒子径 Average particle size (nm)		15.0	40.0	72.0	82.5
標準入数 Standard Net weight		20kg	20kg	20kg, 260kg	20kg

用途:サファイア、CaF₂、BGO、LiTaO₃、LiNbO₃その他の酸化物結晶
applications:sapphire, CaF₂, BGO, LiTaO₃, LiNbO₃ and other oxide crystals

項目 Item	製品名 Type	EX-3	403
SiO ₂ 量 Content of SiO ₂ (%)		50	46
PH		9.5	9.3
比重 Specific gravity		1.385	1.340
平均粒子径 Average particle size (nm)		32.5	39.0
標準入数 Standard Net weight		20kg	20kg

用途:サファイア、CaF₂、BGO、LiTaO₃、LiNbO₃その他の酸化物結晶
applications:sapphire, CaF₂, BGO, LiTaO₃, LiNbO₃ and other oxide crystals

FZ

Fujimi Glass Polish

■FZ

FZ-05、及びFZ-02は酸化ジルコニウム (ZrO₂) の超微粒子からなり、モリブデン、タンガステン、クロミウム、チタニウム、ニッケルなどの特殊合金の研磨に最適です。

FZ使用時に硬質ウレタンパッドや研磨用ピッチを用いますと、金属特有の深みのあるスクラッチフリーの光沢面が得られます。又、光学レンズのファイナルポリッシングにFZ-02を使用しますと、スクラッチフリーでしかも「荒れ」のないレンズ面や「ウェーブ」を取り除いた鮮やかな干渉縞が得られます。



この写真はイメージです。This photograph is an image.

■FZ

FZ-05 and FZ-02 are composed of ultra-fine zirconium oxide particles, and are optimum for polishing special metals such as molybdenum, tungsten, chromium, titanium and nickel, and their alloys. When FZ is used with a hard urethane pad and polishing pitch, it provides the deep, scratch free luster unique to metals. FZ-02 can also be used for final polishing of optical lenses for scratch free, bump free lens, and clear interference image free of waves.

FZの代表的物性 Typical Physical Properties of FZ

項目 Item	製品名 Type	FZ02	FZ05
平均粒子径・SEM Average particle size(μm)		0.2	0.5
pH		5.5	7.0
化学成分(ZrO ₂) Chemical Composition(ZrO ₂)		98.0%	98.0%

CLEALITE

Metal Ultra Super Polish

■CLEALITE

CLEALITEは銅、アルミニウム、ステンレス、チタニウムなど各種一般金属向け鏡面仕上げ材です。“2340”は特殊組成液とともにメカノケミカルポリッシング作用にて、10nm (Rmax) の表面粗さとスクラッチフリーの表面に仕上げることが可能なポリッシングスラリーです。

“S”は分散性の良いシリカパウダーをベースに、選択加工を抑制する組成液をバランス良く配合した金属材料専用のファイナルポリッシングスラリーとして開発され、使用方法及び使用条件は“2340”と全く同じです。“2340”に比べ加工時間の短縮と鏡面精度の向上が可能です。



この写真はイメージです。This photograph is an image.

■CLEALITE

CLEALITE is a polishing slurry for all kinds of metals, including aluminum, stainless steel and titanium to produce mirror finish. The 2340 type has special additives that delivers scratch free surface with surface roughness of 10nm (Rmax). The S type is based on colloidal silica slurry balanced with special additives to control selective processing, and has been specifically developed as final polishing slurry for metals. The polishing method and conditions are same for both 2340 type and S type, but S type provides higher removal rate and better surface performance.

CLEALITEの代表的物性 Typical Physical Properties of CLEALITE

項目 Item	製品名 Type	2340	S
平均粒子径・SEM Average particle size(nm)		15.0	72.0
pH		10.0	8.8
比重 Specific gravity		1.210	1.200